

# 赤外線アレイセンサフォーラム 2012

- 日時：2012年8月3日(金) 10:30~19:00
- 場所：立命館大学びわこ・くさつキャンパス ローム記念館
- 主催：立命館大学
- 後援：立命館大学 先端マイクロ・ナノシステム技術研究センター
- 会費：講演会/展示/ポスター 無料、懇親会 3000円

## ■ プログラム (講演者敬称略)

### 技術講演 (5階 大会議室)

10:00~10:30 PAD法による赤外線透過材料のプレス加工

株式会社村田製作所 八戸 啓

10:30~11:00 赤外線による呼気中アルコール検出

株式会社豊田中央研究所 藤塚 徳夫

11:00~11:30 MEMS式赤外線可変分光器

株式会社デンソー 和戸 弘幸

\*\*\*\*\*

11:30~13:30 昼食

展示/ポスター (3階 レセプションホール)

\*\*\*\*\*

### 技術講演 (5階 大会議室)

13:30~14:00 Infrared Sensor Technology in Korea

KAIST Hee Chul Lee (Korea)

14:00~14:30 IFRPA Development at SCD

SCD Jacob Baeloha (Israel)

14:30~15:00 200万画素SOIダイオード方式非冷却赤外線イメージセンサ

三菱電機株式会社 藤澤 大介

15:00~15:30 休息 & 展示/ポスター

15:30~16:00 2K画素サーモパイル赤外線イメージセンサーの開発

ラピスセミコンダクタ株式会社 渡辺 実

16:00~16:30 赤外線画像の高精細化技術

NEC Avio 赤外線テクノロジー 木村 彰一

16:30~17:00 福島第一原子力発電所の赤外線放射温度計測

防衛省 土志田 実

### 懇親会/展示/ポスター (3階 レセプションホール)

17:15~19:00 懇親会 & 展示/ポスター